1/12, 2021

次世代光デバイス研究会 令和２年度講演会

―　深紫外 LED の評価技術と産業応用の最新動向　―

紫外域の光源（波長 200～400nm）は照射物に種々の化学変化を起こすことが可能なため、樹脂硬化（レジストの露光、印刷インク・接着剤など）、殺菌、表面改質、医療など広範な産業用途に利用されてきました。最近、水銀ランプやメタルハライドランプに代わる紫外光源として高出力の深紫外 LED 光源の産業利用が進み、その市場規模も急速に拡大しています。

本講演会ではこのような深紫外 LED 光源の放射測定と殺菌への応用に関する２件の講演、および弊所に設置した UV-LED の測光装置の紹介をいたします。

開催日時：令和３年３月３日　14:00～16:50

開催方法：オンライン（Cisco Webex）

参加お申込みをいただいた方には、後日、講演会への参加方法をご連絡いたします。

参 加 費：無料

参加定員：100 名（先着）

講演会次第：

１．開会挨拶　14：00　～14：05

２．話題提供

（１）深紫外 LED の展望と技術トレンド　14：10　～15：00

講師：スタンレー電気株式会社　光半導体事業部　有山 恵人氏

概要：安心・安全な社会作りをキーワードに、殺菌市場は広がりを見せておりさらに光源がランプから LED に置き換わることにより、新たな市場も形成されていきます。本講演では市場で求められる深紫外 LED のスペックと、当社の開発動向をご紹介させて頂きます。

（２）UVC-LED の放射測定技術の現状と課題　15：10　～16：00

講師：山形大学工学部　大学院理工学研究科　大久保　和明氏

概要：UVC 波長領域の LED の開発が実用段階となり、産業応用として広く使用されるに至っています。一方この光放射特性を評価する波長 300nm 以下の放射測定技術は、可視波長域の測定に比べ、不確かさもかなり大きくなります。本講演ではその技術的な課題である測光標準のトレーサビリティや分光測定器の特性について解説します。

（３）UV-LED の測光装置の紹介　16：10　～16：30

講師：(地独)大阪産業技術研究所　森之宮センター　北口　勝久

概要：当研究所の測光施設（次世代光デバイス評価支援センター）に導入しました紫外 LED 光源の測光装置の紹介をさせていただきます。

３．質疑　16：30　～16：45

４．閉会挨拶　16：45　～16：50

次世代光デバイス研究会 令和２年度講演会

参　加　申　込

次世代光デバイス研究会
　事務局　齋藤宛

　E-mail：　saito@omtri.or.jp
　FAX：　06-6963-8145

お名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

貴社名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　ご所属・部署＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

所在地　〒＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

TEL＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　FAX＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　E-mail＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿